

1	<p>(水濁法施行令別表第1 19号)</p> <p><u>紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <p>イ まゆ湯煮施設</p> <p>ロ 副蚕処理施設</p> <p>ハ 原料浸せき施設</p> <p>ニ 精練機及び精練そう</p> <p>ホ シルケツト機</p> <p>ヘ 漂白機及び漂白そう</p> <p>ト 染色施設</p> <p>チ 薬液浸透施設</p> <p>リ のり抜き施設</p>
2	<p>(水濁法施行令別表第1 22号)</p> <p><u>木材薬品処理業の用に供する施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <p>イ 湿式バーカー</p> <p>ロ 薬液浸透施設</p>
3	<p>(水濁法施行令別表第1 23号の2)</p> <p><u>新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフィルム of 現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。)</u></p>
4	<p>(水濁法施行令別表第1 24号)</p> <p><u>化学肥料製造業の用に供する施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <p>イ ろ過施設</p> <p>ロ 分離施設</p> <p>ハ 水洗式破碎施設</p> <p>ニ 廃ガス洗浄施設</p> <p>ホ 湿式集じん施設</p>
5	【削除】
6	<p>(水濁法施行令別表第1 26号)</p> <p><u>無機顔料製造業の用に供する施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <p>イ 洗浄施設</p> <p>ロ ろ過施設</p> <p>ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機</p> <p>ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設</p> <p>ホ 廃ガス洗浄施設</p>
7	<p>(水濁法施行令別表第1 27号)</p> <p><u>無機顔料製造業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設(水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。))又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐りんの製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <p>イ ろ過施設</p> <p>ロ 遠心分離機</p> <p>ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設</p> <p>ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設</p> <p>ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設</p> <p>ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設</p> <p>ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設</p> <p>チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設</p> <p>リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設</p> <p>ヌ 廃ガス洗浄施設</p> <p>ル 湿式集じん施設</p>

8	<p>(水濁法施行令別表第1 28号)</p> <p><u>カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 湿式アセチレンガス発生施設</li> <li>ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設</li> <li>ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設</li> <li>ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設</li> <li>ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設</li> <li>ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設</li> </ul>
9	<p>(水濁法施行令別表第1 28号)</p> <p><u>コールタール製品製造業の用に供する施設</u>であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ ベンゼン類硫酸洗浄施設</li> <li>ロ 静置分離器</li> <li>ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設</li> </ul>
10	<p>(水濁法施行令別表第1 31号)</p> <p><u>メタン誘導品製造業の用に供する施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設</li> <li>ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設</li> <li>ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設</li> </ul>
11	<p>(水濁法施行令別表第1 32号)</p> <p><u>有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設</u>であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ ろ過施設</li> <li>ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設</li> <li>ハ 遠心分離機</li> <li>ニ 廃ガス洗浄施設</li> </ul>
12	<p>(水濁法施行令別表第1 33号)</p> <p><u>合成樹脂製造業の用に供する施設(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤として使用するふっ素樹脂の製造の用に供するもの、一・四・ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレート製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 縮合反応施設</li> <li>ロ 水洗施設</li> <li>ハ 遠心分離機</li> <li>ニ 静置分離器</li> <li>ホ ふっ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設</li> <li>ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設</li> <li>ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設</li> <li>チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設</li> <li>リ 廃ガス洗浄施設</li> <li>ヌ 湿式集じん施設</li> </ul>
13	<p>(水濁法施行令別表第1 34号)</p> <p><u>合成ゴム製造業の用に供する施設(テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは二クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ ろ過施設</li> <li>ロ 脱水施設</li> <li>ハ 水洗施設</li> <li>ニ ラテックス濃縮施設</li> <li>ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器</li> </ul>
14	<p>(水濁法施行令別表第1 35号)</p> <p><u>有機ゴム薬品製造業の用に供する施設(二クロロエチルビニルエーテルの製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 蒸留施設</li> <li>ロ 分離施設</li> <li>ハ 廃ガス洗浄施設</li> </ul>

15	<p>(水濁法施行令別表第1 第37号)</p> <p>前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、<u>第五十一号に掲げる事業を除く。</u>)の用に供する施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料として使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒として使用して製造するものに限る。))若しくはエチレンオキシドの製造の用に供するもの又はエチレンオキシドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するものに限る。)であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 洗浄施設</li> <li>ロ 分離施設</li> <li>ハ ろ過施設</li> <li>ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設</li> <li>ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設</li> <li>ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設</li> <li>ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設</li> <li>チ エチレンオキシド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設</li> <li>リ ニーエチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設</li> <li>ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設</li> <li>ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設</li> <li>ヲ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設</li> <li>ワ プロピレンオキシド又はプロピレングリコールのけん化器</li> <li>カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設</li> <li>ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設</li> <li>タ 廃ガス洗浄施設</li> </ul>
16	<p>(水濁法施行令別表第1 第38号の2)</p> <p>界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四―ジオキサンが発生するものに限る。、洗浄装置を有しないものを除く。)</p>
17	<p>(水濁法施行令別表第1 第41号)</p> <p>香料製造業の用に供する施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。))であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 洗浄施設</li> <li>ロ 抽出施設</li> </ul>
18	<p>(水濁法施行令別表第1 第43号)</p> <p>写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設</p>
19	<p>(水濁法施行令別表第1 第46号)</p> <p>第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設(有害物質若しくはこれらを含む物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四―ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するものに限る。))であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 水洗施設</li> <li>ロ ろ過施設</li> <li>ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設</li> <li>ニ 廃ガス洗浄施設</li> </ul>
20	<p>(水濁法施行令別表第1 第47号)</p> <p>医薬品製造業の用に供する施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しくはこれらを含む物質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四―ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。))であって、次に掲げるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 動物原料処理施設</li> <li>ロ ろ過施設</li> <li>ハ 分離施設</li> <li>ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含む物を混合するものに限る。以下同じ。)</li> <li>ホ 廃ガス洗浄施設</li> </ul>

2 1	(水濁法施行令別表第 1 第 48 号) <u>火薬製造業の用に供する洗浄施設 (ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。)</u>
2 2	(水濁法施行令別表第 1 第 50 号) <u>第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 (トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・四・ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。)</u>
2 3	(水濁法施行令別表第 1 第 51 号) 石油精製業 (潤滑油再生業を含む。) の用に供する施設 <u>(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄の用に供するものに限る。)</u> であって、次に掲げるもの イ 脱塩施設 ロ 原油常圧蒸留施設 ハ 脱硫施設 ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 ホ 潤滑油洗浄施設
2 4	(水濁法施行令別表第 1 第 53 号) <u>ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 (硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しくはその化合物を使用する研磨洗浄の用に供するものに限る。)</u> であって、次に掲げるもの イ 研磨洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設
2 5	(水濁法施行令別表第 1 第 58 号) <u>窯業原料 (うわ薬原料を含む。) の精製業の用に供する施設 (ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原料の精製の用に供するものに限る。)</u> であって、次に掲げるもの イ 水洗式破碎施設 ロ 水洗式分別施設 ハ 酸処理施設 ニ 脱水施設
2 6	(水濁法施行令別表第 1 第 61 号) <u>鉄鋼業の用に供する施設 (コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用に供するものに限る。)</u> であって、次に掲げるもの イ タール及びガス液分離施設 ロ ガス冷却洗浄施設 ハ 圧延施設 ニ 焼入れ施設 ホ 湿式集じん施設
2 7	(水濁法施行令別表第 1 第 62 号) <u>非鉄金属製造業の用に供する施設 (銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の用に供するものに限る。)</u> であって、次に掲げるもの イ 還元そう ロ 電解施設 (熔融塩電解施設を除く。) ハ 焼入れ施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設 ヘ 湿式集じん施設
2 8	(水濁法施行令別表第 1 第 63 号) <u>金属製品製造業又は機械器具製造業 (武器製造業を含む。) の用に供する施設 (液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に供するものに限る。)</u> であって、次に掲げるもの イ 焼入れ施設 ロ 電解式洗浄施設 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設
2 9	(水濁法施行令別表第 1 第 63 号の 3) 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設

30	<p>(水濁法施行令別表第1 第64号)</p> <p><u>ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供するものに限る。)</u>であって、次に掲げるもの</p> <p>イ タール及びガス液分離施設</p> <p>ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)</p>
31	<p>(水濁法施行令別表第1 第65号)</p> <p><u>酸又はアルカリによる表面処理施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふっ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。)</u></p>
32	<p>(水濁法施行令別表第1 第66号)</p> <p><u>電気めっき施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふっ素化合物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めっきの用に供するものに限る。)</u></p>
33	<p>(水濁法施行令別表第1 第66号の2)</p> <p>エチレンオキシド又は一・四・ジオキサン<small>の混合施設(前各号に該当するものを除く。)</small></p>
34	<p>(水濁法施行令別表第1 第71号の5)</p> <p>トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設<small>(前各号に該当するものを除く。)</small></p>
35	<p>(水濁法施行令別表第1 第71号の6)</p> <p>トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設<small>(前各号に該当するものを除く。)</small></p>

福島県生活環境の保全等に関する条例に係る排水指定施設(規則第20条に掲げる施設)

1	水産食料品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 冷凍すり身の解凍施設 イ 混練施設
2	野菜作農業（もやし栽培農業に限る。）の用に供する洗浄施設
3	電子部品・デバイス製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 研摩施設 イ 洗浄施設
4	窯業・土石製品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第二項に規定する特定施設を除く。） ア 切削施設 イ 研摩施設 ウ 洗浄施設 エ 混合施設 オ 成型施設 カ 表面処理施設
5	放送業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
6	鉄道業の用に供する鉄道用車両の整備施設
7	サービス業の用に供する自動車洗浄施設（ <u>コイン洗車施設を二台以上設置するものに限り、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を除く。</u> ）
8	一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第八条第一項に規定するものをいう。）である <u>一般廃棄物の最終処分場</u> （昭和五十二年三月十五日において既に設置されていたものを除く。）
9	産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号）第七条第十四号ロ及びハに掲げるものをいう。）である <u>産業廃棄物の最終処分場</u> （昭和五十二年三月十五日において既に設置されていたものを除く。）
10	電気業の用に供する廃ガス洗浄施設（水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を除く。）
11	ゴルフ場（ゴルフ競技の用に供するものであって、九ホール以上を有するものに限る。）